

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 25 年 4 月 4 日 (2013.4.4)

【公開番号】特開 2011-176147 (P2011-176147A)
 【公開日】平成 23 年 9 月 8 日 (2011.9.8)
 【年通号数】公開・登録公報 2011-036
 【出願番号】特願 2010-39386 (P2010-39386)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

H 0 5 H 1/46 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/302 1 0 1 D

H 0 5 H 1/46 C

【手続補正書】
 【提出日】平成 25 年 2 月 20 日 (2013.2.20)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

内部を電界が伝播する円形導波管と、この円形導波管の下方に接続されて配置され前記円形導波管より径の大きな円柱状の空洞部と、この空洞部の下方に配置され当該空洞部に伝播された電界が内部に供給されてプラズマが形成されるプラズマ処理室とを有し、このプラズマ処理室内に配置された被処理基板を前記プラズマを用いて処理するプラズマ処理装置であって、

前記円形導波管が接続される前記空洞部の内部であってその上部に円環状に配置されたリッジを備えたプラズマ処理装置。

【請求項 2】

内部を電界が伝播する円形導波管と、この円形導波管の下方に接続されて配置され前記円形導波管より径の大きな円柱状の空洞部と、この空洞部の下方に配置され当該空洞部に伝播された電界が内部に供給されてプラズマが形成されるプラズマ処理室とを有し、このプラズマ処理室内に配置された被処理基板を前記プラズマを用いて処理するプラズマ処理装置であって、

前記円形導波管の下端部と前記空洞部の上部との間でこれらを接続して配置され下方に向けて径が広がったその断面がテーパ状のテーパ導波管と、前記円形導波管が接続される前記空洞部の内部であってその上部に円環状に配置されたリッジを備えたプラズマ処理装置。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 1 0
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 1 0】

本発明のプラズマ処理装置は、内部を電界が伝播する円形導波管と、この円形導波管の下方に接続されて配置され前記円形導波管より径の大きな円柱状の空洞部と、この空洞部の下方に配置され当該空洞部に伝播された電界が内部に供給されてプラズマが形成される

プラズマ処理室とを有し、このプラズマ処理室内に配置された被処理基板を前記プラズマを用いて処理するプラズマ処理装置であって、前記円形導波管が接続される前記空洞部の内部であってその上部に円環状に配置されたリッジを備えるものである。また、前記円形導波管の下端部と前記空洞部の上部との間でこれらを接続して配置され下方に向けて径が広がったその断面がテーパ状のテーパ導波管と、前記円形導波管が接続される前記空洞部の内部であってその上部に円環状に配置されたリッジを備えることもできる。